

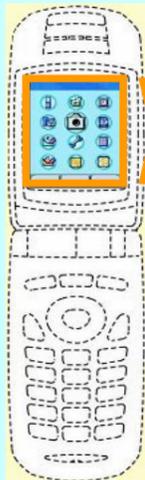
# 「意匠法等の一部を改正する法律」検討と対応

2006年6月7日法律第55号として公布

- 【主な改正点】** ①画面デザイン保護拡大 ②関連・部分・部品意匠出願時期緩和  
 ③権利期間延長 ④実施行為へ輸出追加 ⑤間接侵害に所持行為追加 ⑥刑事罰強化 等

## 攻めと守いのバランス よい良い制度とは？

### 画面デザイン保護の検討



- \* GUIを部分意匠で保護
- \* 階層画面も保護対象
- \* 物品自体も差止め？
- \* 権利範囲どこまで？

特許庁と協議を図り  
あるべき制度運用追求

## 新制度を如何に 活用すべきか！！

### 実務戦略の検討

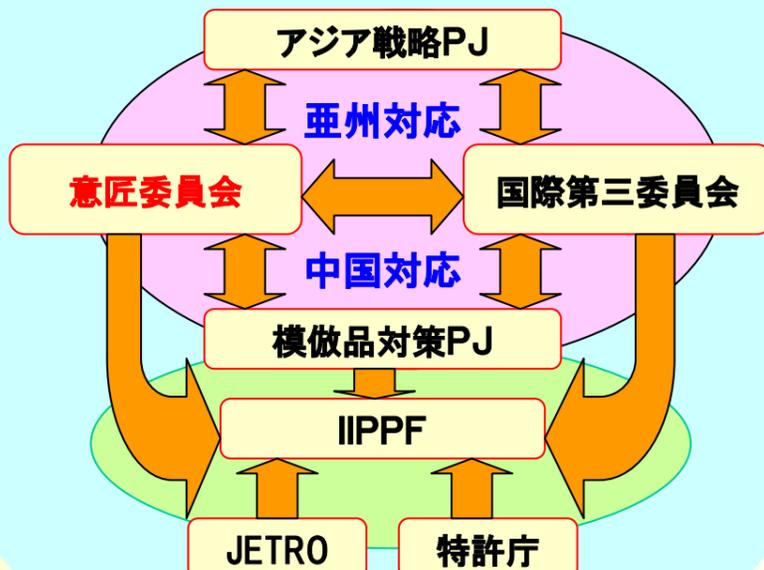
- \* 実施製品をどう守る？
- \* 新規保護対象への対応は？
- \* 社内運用をどう変える？
- \* 侵害回避の対応は？

臨時研修会で解説  
改正法Q&Aで周知

# アジア法改正等対応／実務運用研究

- 【本年改正対応】** 中国専利法改正案（その他台湾・韓国）  
**【本年制度意見】** 中国・韓国・台湾・インド等へ意見発信  
**【実務運用研究】** 国内・海外IPDLの意匠権利調査ツールの比較研究

## 対外施策には一致団結 連携・協力で対応！！



## オリジナリティ追求 権利活用の活性化へ

### 権利調査活動を重要視



日本・中国・韓国・米国・欧州・台湾  
IPDL研究

2月度部会報告予定

## 中国専利法(意匠部分)の改正案について

- 【動向】** 2006年 国家知識産権局から改正条文案の公表  
2007年 全国人民代表大会での法案検討  
2008年 改正法施行（見込み）

- 【改正が見送られる項目】** ① 審査主義の導入と部分意匠制度の導入  
② 実施行為の拡大（「販売の申出」の追加）

### 【主な改正点】

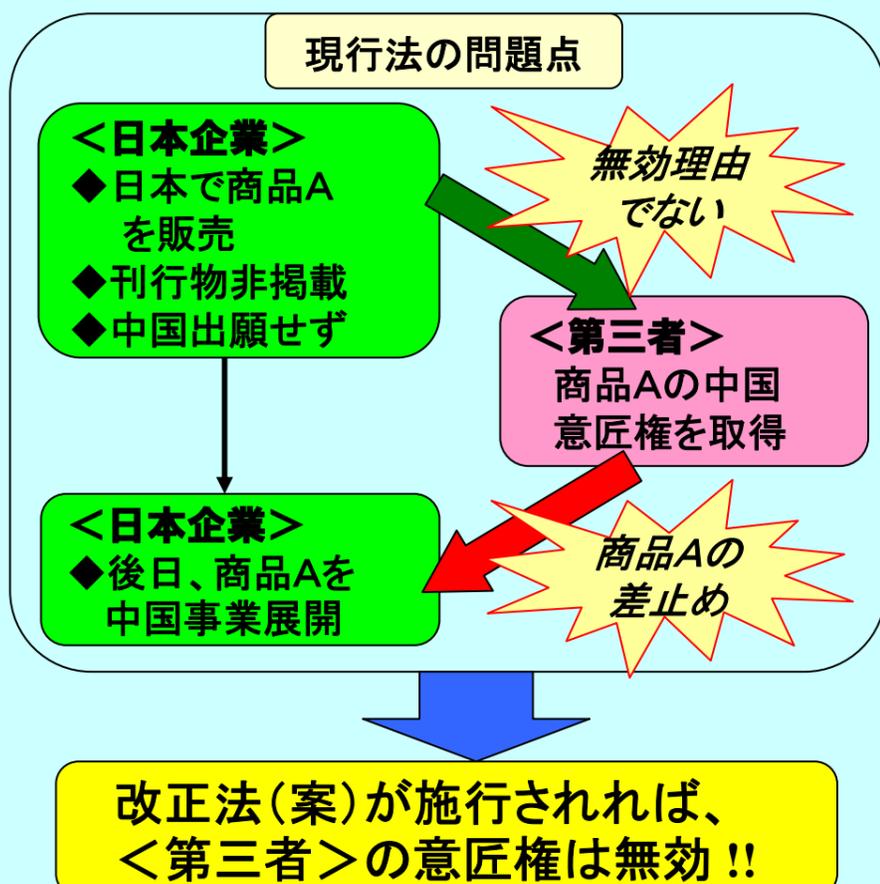
- ① 世界公知公用の導入
- ② 創作非容易性の登録要件への追加

### 【手続き面の改正点】

- ① 「検索報告書」の提出義務化（権利行使時）
- ② 「意匠の簡単な説明」等の文書提出義務化（出願時）
- ③ 関連意匠制度の導入（多意匠一出願）
- ④ 平面印刷物の意匠の登録除外

## 安定した中国事業が可能に…

### ① 世界公知公用の導入



### ② 創作非容易性の追加

